NI	
Name:	

Klausur: Grundlagen der Elektronik SS 10

Kurzfragen ohne Unterlagen (Bearbeitungszeit: 30 min)

- 1) Gegeben ist das Bändermodell W(x) von n-dotiertem Si. Skizzieren Sie die Zustandsdichten der Elektronen im Leitungsband und der Löcher im Valenzband D(W) in parabolischer Näherung, sowie die Fermi-Verteilung f(W) und die Elektronen- und Löcherkonzentrationen im Leitungs- bzw. Valenzband n(W), p(W) in den vorbereiteten Koordinatensystemen.
- 2) Welche der Aussagen zu einem idealen pn-Übergang mit angelegter Spannung U sind zutreffend?
- 3) Welche der Aussagen zur Kapazität *C* einer *pn*-Diode mit abruptem Übergang und homogenen Dotierungen sind zutreffend?
- 4) Welche der Aussagen zu dem gezeigten Bändermodell mit den Bandkanten $W_{\rm V}$ und $W_{\rm L}$ sowie den beiden Quasi-Ferminiveaus $W_{\rm Fn}$ und $W_{\rm Fp}$ für die Elektronen und Löcher sind richtig unter der Voraussetzung gleicher effektiver Zustandsdichten im Leitungs- und Valenzband?
- Skizzieren Sie in den vorbereiteten Diagrammen die örtlichen Verläufe der Raumladungsdichte $\rho(x)$, des elektrischen Feldes E(x) und des Bändermodells W(x) in der angedeuteten, idealen Metall-Oxid-n-Halbleiterstruktur für den Fall der starken Inversion. Beschriften Sie W_F , W_L , W_V sowie die angelegte Spannung U. Welches Vorzeichen muss dann die Spannung am Metall gegenüber dem Halbleiter aufweisen?
- 6) Die Steilheit eines FET mit isoliertem Gate kann erhöht werden, wenn man ...
- Gegeben ist eine ideale Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur (Bild a) mit gleichen Austrittsarbeiten von Halbleiter und Metall sowie in den Bildern c bis e die zugehörigen Bändermodelle für drei Arbeitspunkte. Um welchen Halbleitertyp handelt es sich? Zeichnen Sie für niedrige Frequenzen den $C(U_g)$ -Verlauf in das Diagramm (Bild b). Markieren Sie die Arbeitspunkte der drei angegebenen Bändermodelle mit dem zugehörigen Buchstaben (c bis e) in der $C(U_g)$ -Kennlinie.
- 8) Welche der Aussagen zu einer MOS-Kapazität sind zutreffend?
- 9) Welche der Aussagen zum Bipolartransistor sind richtig?
- 10) Skizzieren Sie in dem vorbereiteten Diagramm den Konzentrationsverlauf der Minoritätsladungsträger in der neutralen Basis (x_2 bis x_3) eines npn-Transistors (Diffusionsdreieck).

 Vernachlässigen Sie die Variation der Verarmungszonenbreiten mit der Spannung.

 Markieren Sie die Verläufe mit dem Buchstaben der Teilaufgaben: U_{eb} : Emitter-BasisSpannung und U_{cb} : Kollektor-Basis-Spannung.

 Geben Sie die Minoritätsladungsträgerkonzentration $n_a(x_2)$ in Abhängigkeit von U_{eb}

Geben Sie die Minoritätsladungsträgerkonzentration $n_{\rm p}(x_2)$ in Abhängigkeit von $U_{\rm eb}$ formelmäßig an.



Nam	e:		
140111	L	 	

Klausur: Grundlagen der Elektronik SS 10

Aufgaben (Bearbeitungszeit: 2 Std.)

 Ein n-Halbleiter hat bei T₀ = 300 K gleiche Elektronen- und Löchermassenn und -beweglichkeiten µ und eine Dotierungskonzentration N_D>> n_c. Die effektiven Zustandsdichten und die Beweglichkeiten hängen von der Temperatur T ab gemäß:

$$N_{L}(T) = N_{V}(T) = N_{0} \left(\frac{T}{T_{0}}\right)^{3/2}; \quad \mu_{p}(T) = \mu_{n}(T) = \mu_{0} \left(\frac{T_{0}}{T}\right)^{3/2}.$$

a) Leiten Sie hieraus die Temperaturabhängigkeit der Eigenleitungskonzentratiow, (T) formelmäßig ab. Ermitteln Sie anschließend die Temperaturabhängigkeiten der spezifischen Leitfähigkeit σ(T) für die Fälle der Eigenleitung (1) und der Störstellenerschöpfung (2). Die abgeleiteten Formeln sollen jeweils alle Temperaturabhängigkeiten explizit enthalten.

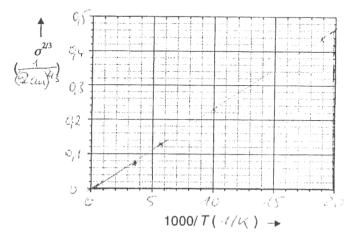
$$n_i = \sqrt{N_L N_V} \exp \left(-\frac{W_Q}{2kT}\right)$$
; $\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$

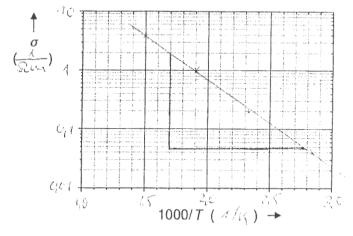
- b) Formen Sie die unter a) abgeleiteten Temperaturabhängigkeiten σ(T) für Eigenleitung (1) bzw. Störstellenerschöpfung (2) so um, dass sich in Abhängigkeit von 1/T jeweils eine lineare Funktion f(σ) = m · (1/T) + n ergibt. Geben Sie m und n für die beiden Fälle (1) und (2) formelmäßig an.
- c) Der betrachtete Halbleiter weist folgende Werte für σ in Abhängigkeit von T auf,

1	1	1	I	1	1	1	f	
T(K)	53	100	175	270	350	420	525	665
$\sigma(1/\Omega \text{cm})$	0,3	0,11	0,05	0,02	0,04	0,2	1,0	4,0
Bereich	(c) Storgellaces supplies			(1) Enjewleiding				
1000/T (1/K)	18,9	100	5.7	8,4	2,85	2,32	1,9	1,5
(36/2 Tex)	944	423	613	0.07				

wobei der Übergang zwischen den Bereichen (1) und (2) bei 310 K liegt. Ordnen Sie die Spalten 1 bis 4 bzw. 5 bis 8 den Bereichen Eigenleitung (1) bzw. Störstellenerschöpfung (2) zu und geben Sie dies in der dritte Zeile an. Ergänzen Sie in der Tabelle auch die fehlenden Werte von 1000/T (vierte Zeile) sowie die für die eine Geradendarstellung gemäß b) umzurechnenden Werte vow (nur in einem der beiden

Fälle erforderlich, fünfte Zeile). Tragen Sie die ermittelten Werte nun getrennt für die beiden Bereiche (1) und (2) in das jeweils zugehörige Diagramm ein (beachten Sie die unterschiedlichen Skalierungen). Ergänzen Sie die Achsenbeschriftung. Bestimmen Sie aus den Werten im Eigenleitungsbereich den Bandabstand W_G und aus den Werten im Bereich der Störstellenerschöpfung die Dotierungskonzentration N_D (geg. Daten: $\mu_0 = 1300 \, \mathrm{cm}^2/\mathrm{V}\,\mathrm{s}$; $q = 1,6\cdot10^{-19}\,\mathrm{C}$; $k = 8,62\cdot10^{-5}\,\mathrm{eV/K}$).





1) (1)
$$n_{10} = |N_{1}| \exp(-\frac{M_{1}}{2kT}) = |N_{1}|^{2} \frac{T}{T_{0}}|^{3} \exp(-\frac{M_{1}}{2kT})$$

$$= N_{10} \left(\frac{T}{T_{0}}\right)^{2} \exp(-\frac{M_{1}}{2kT})$$

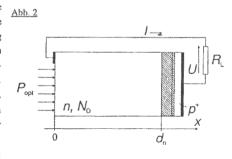
$$= (1) \frac{T}{2} \exp(-\frac{M_{1}}{2kT})$$

$$= (2) \frac{T}{2} \exp(-\frac{M_{1}}{2kT}) \exp(-\frac{M_{1}}{2kT})$$

$$= (2) \frac{T}{2} \exp(-\frac{M_{1}}{2$$

Name:

2) Abb. 2 zeigt eine Diode, die bei 300 K als Solarzelle betrieben wird. Bestrahlung durch das n-Gebiet führt zu einer ortsabhängigen Generation mit einer auf die Fläche A bezogenen Rate g(x). Thermische Generation von Ladungsträgern in der Verarmungszone (Abb. 2, schraffierter Bereich) und ein Spannungsabfall über den



Bahngebieten können vernachlässigt werden. Der Lastwiderstand ist so dimensioniert, dass sich ein Spannungsabfall U = 0.4 V ergibt.

a) Stellen Sie die Differenzialgleichung auf, die im eingeschwungenen Zustand den Verlauf der Löcherkonzentration p_n(x) im n-Bahngebiet beschreibt. Nutzen Sie die Kontinuitätsgleichung: dp_n/dt = -1/q(dJ_p/dx)-r_{net}+g mit Diffusionsstromdichte-Gleichung: J_p = -qD_p(dp_n/dx), thermischer Nettorekombinationsrate: r_{net} = (p_n-p_{n0})/τ_p, optischer Generationsrate: g(x) = g₀exp(-ᾱx), Diffusionslänge: L_p = (D_pτ_p)^{1/2} und Gleichgewichtskonzentration der Löcher im n-Bahngebiet p_{n0}.

Ermitteln Sie die Löcherkonzentration an den Rändern des n-Bahngebietes, d.h. bei x=0 [Hinweis: hier liegt thermisches Gleichgewicht vor] und bei $x=d_a$ [Hinweis: $p_n(d_n)=p_{n0}\exp(W/kT)$; W ist eine Funktion von U]. Lösen Sie nun die Differenzialgleichung unter Verwendung des Ansatzes:

$$p_n(x) - p_{n0} = A \sinh\left(\frac{x}{L_p}\right) + B \sinh\left(\frac{x - d_n}{L_p}\right) + C \exp\left(-\overline{\alpha}x\right).$$

Geben Sie getrennt die Anteile der ohne Bestrahlung vorliegenden und der photogenerierten Löcherkonzentrationen an. Nähern und skizzieren Sie qualitativ den Verlauf der Konzentration der photogenerierten Ladungsträger $p_{\rm ph}(x)$ im n-Bahngebiet für den Fall, dass $\bar{\alpha}^2 >> 1/L_{\rm p}^2$, $d_{\rm n} << L_{\rm p}$ und $\exp(-\bar{\alpha}d_{\rm p}) << 1$ (nutzen Sie die Vorlage).

3

Fig. 1. South of
$$\frac{df_1}{dt} = 0 = -\frac{d}{2}\frac{dA_1}{dA_2} - \frac{r_{net} + g}{r_{net}} + \frac{g}{d} = \frac{r_1}{dA_2} - \frac{r_1 - r_{ne}}{r_p} + \frac{g}{g} \exp \left(-\frac{r_1}{A_2}\right)$$

Les $\frac{df_1}{dX^2} - \frac{r_1 - r_{ne}}{D_p} + \frac{g}{D_p} \exp \left(-\frac{r_1}{A_2}\right)$

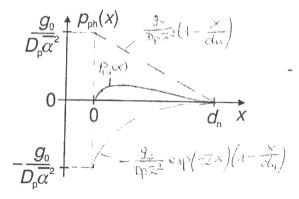
Les $\frac{df_1}{dX^2} - \frac{r_1 - r_{ne}}{D_p} + \frac{g}{D_p} \exp \left(-\frac{r_1}{A_2}\right)$

Les $\frac{df_1}{dX^2} - \frac{r_1}{r_1} - \frac{r_1}{dx} + \frac{g}{D_p} \exp \left(-\frac{r_1}{A_2}\right)$

Les $\frac{df_1}{dX^2} - \frac{r_1}{r_1} - \frac{g}{D_p} \exp \left(-\frac{r_1}{A_2}\right)$

Les $\frac{df_1}{dX^2} - \frac{r_1}{r_1} = \frac{g}{D_p} \exp \left(-\frac{r_1}{A_2}\right)$

Les $\frac{df_1}{dX^2} - \frac{r_1}{r_1} = \frac{g}{D_p} \exp \left(-\frac{r_1}{R_1}\right) + \frac{g}{D_p} \exp \left(-\frac{r_1}{R_1}\right)$



- Berechnen Sie den Diffusionskoeffizient $D_p = \mu_p kT/q$, die Diffusionslänge L_p sowie $p_{n0} = n_i^2/N_D$ und überprüfen Sie die Annahmen in a) unter Verwendung der Zahlenwerte: $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/\text{Vs}$; T = 300 K; $k = 8.62 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}$; $q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $\tau_p = 25 \text{ }\mu\text{s}$; $n_i = 5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$; $N_D = 7 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$; $\bar{\alpha} = 2 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-1}$, $d_n = 12 \text{ }\mu\text{m}$.
- c) Bestimmen Sie aus $p_{\rm ph}$ den Photostrom $I_{\rm ph}$ durch die Diode (Formel und Wert; $A=1.5~{\rm mm^2},\,g_0=7\cdot10^{19}\,{\rm /(cm^3s)}).$

Name:....

- Analysieren Sie die Schaltung in <u>Abb. 3a</u>. Der Transistor ist durch das Kennlinienfeld in <u>Abb. 3 b</u> charakterisiert. Folgende Betriebsparameter sind gegeben: U_B = 3,5 V, U_{ce} = 2 V, U_{cb} = -0,8 V, I_b = 12,5 μA, I_c = 5·I_b, R_G = 10 kΩ, R_I = 2 kΩ.
 - a) Welcher Transistortyp liegt vor? Zeichnen Sie das Gleichstromersatzschaltbild. Ermitteln Sie den Arbeitspunkt $I_c(U_{cc})$ und U_E sowie die Widerstände R_1 , R_2 und R_E . Wie groß ist I_c ($U_{ce} = 0$)? Tragen Sie Arbeitspunkt und -gerade in das Kennlinienfeld ein.
 - b) Führen Sie eine Wechselstromanalyse durch. Welcher Schaltungstyp liegt vor? Zeichnen Sie hierzu die Ersatzschaltung unter Verwendung des y-Parameter-Ersatzschaltbildes in <u>Abb. 3c</u> für den Transistor. Die Kondensatoren stellen im betrachteten Frequenzbereich Kurzschlüsse dar.
 - c) Bestimmen Sie aus b) für y₁₁ = y₁₂ = y₂₂ = 0 und y₂₁ = -5 mS und mit Hilfe der in a) ermittelten Werte den Eingangswiderstand R_ε = u₁li₁, die Stromverstärkung v₁ = i₂li₁, die Leerlaufspannungsverstärkung v₂ = u₂lu₁ (i₂ = 0), die Spannungsverstärkung v₃ = u₂lu₂ (u₃ = 0) und den Ausgangswiderstand R₃ = u₂li₂ (u₃ = 0, i₂ ≠ 0) der Schaltung formel- und zahlenmäßig. Nutzen Sie bei der Herleitung der Formeln sinnvolle Näherungen.

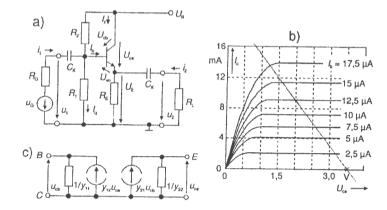


Abb. 3

5

